

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成26年12月25日 (2014.12.25)

【公開番号】特開2011-74358(P2011-74358A)

【公開日】平成23年4月14日 (2011.4.14)

【年通号数】公開・登録公報2011-015

【出願番号】特願2010-175282(P2010-175282)

【国際特許分類】

C 1 1 B 3/10 (2006.01)

C 1 1 B 3/04 (2006.01)

A 2 3 D 9/00 (2006.01)

A 2 3 L 1/30 (2006.01)

【F I】

C 1 1 B 3/10

C 1 1 B 3/04

A 2 3 D 9/00

A 2 3 L 1/30 Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月11日 (2014.11.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

3 - クロロプロパン - 1 , 2 - ジオール、3 - クロロプロパン - 1 , 2 - ジオールの脂肪酸エステル、グリシドール及びグリシドールの脂肪酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも 1 種を含有し、及び / 又は、ジグリセリドを 3 質量 % 以上含有するグリセリド組成物を、100 ~ 240 の温度条件にて脱臭処理し、

前記脱臭処理前及び / 又は前記脱臭処理後に、前記グリセリド組成物を (1) の方法で酸性下に暴露することを特徴とするグリセリド組成物の製造方法。

(1) 前記グリセリド組成物を炭素数 1 ~ 22 の有機酸と、前記グリセリド組成物の酸価が 5 . 8 ~ 10 . 9 となるように 100 ~ 260 で接触させる

【請求項 2】

前記グリセリド組成物は精製油である請求項 1 に記載のグリセリド組成物の製造方法。

【請求項 3】

前記グリセリド組成物を、前記有機酸、並びに、硫酸、リン酸、硝酸及び塩酸からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の無機酸の存在下で酸性下に暴露する請求項 2 に記載のグリセリド組成物の製造方法。

【請求項 4】

3 - クロロプロパン - 1 , 2 - ジオール、3 - クロロプロパン - 1 , 2 - ジオールの脂肪酸エステル、グリシドール及びグリシドールの脂肪酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも 1 種を含有し、及び / 又は、ジグリセリドを 3 質量 % 以上含有するグリセリド組成物を、100 ~ 240 の温度条件にて脱臭処理し、

前記脱臭処理前及び / 又は前記脱臭処理後に、前記グリセリド組成物を (1) の方法で酸性下に暴露することにより、グリセリド組成物中のグリシドールの脂肪酸エステル及び / 又は 3 - クロロプロパン - 1 , 2 - ジオールの脂肪酸エステルを低減又はこれらの生成

を抑制する方法。

(1) 前記グリセリド組成物を炭素数 1 ~ 22 の有機酸と、前記グリセリド組成物の酸価が 5 . 8 ~ 10 . 9 となるように 100 ~ 260 で接触させる